新しい光機能材料 GeC/Si 混晶のエピタキシャル成長技術と その光学的特性の研究

18360010

平成18年度~平成19年度科学研究費補助金 (基盤研究(B))研究成果報告書

平成20年3月31日

研究代表者 布 下 正 宏 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科教授

<はしがき>

情報化社会はますます高度化し、情報量は爆発的に増大している。その将来の基盤としてユビキ タスネットワークや量子情報処理技術の先導的技術革新が強く望まれている。そのためのキーデバ イスはマイクロ波とフォトニクスの融合、すなわち Si LSI と光機能デバイス(シリコンフォトニクス) の集積化が有望視されており、この新しい光機能デバイスでは、量子効果による量子閉じ込めや qubit のような新機能の発現が不可欠であり、10nm 以下の Si 系半導体のナノクリスタル形成とそ の精密配列技術という新しいナノテクノロジーの研究開発が国内外で精力的に進められている。

本研究では、平成 18 年度~平成 19 年度の 2 年間に亘り、奈良先端科学技術大学院大学物質創成 科学研究科のグループがシリコンフォトニクスに必須のシリコンベースの光機能デバイスを目指し て、新しいバイオナノプロセスの開発とともに光機能材料 GeC、β-FeSi₂、Siのナノクリスタルの 二次元超格子の形成技術とその発光特性評価の研究を行ってきた。ここに本研究の成果と得られた 知見をまとめて総括をするとともに、今後の研究課題等について記す。

研究組織

研究代表者:布下正宏(奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授、現 先端科学技術研究調査センター 特任教授)

研究分担者:太田 淳(奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授) 研究分担者:徳田 崇(奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 助教、現 准教授) 研究協力者:中間勇二(奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 博士後期課程 学生、 現 島津製作所)

交付決定額(配分額)

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合計
平成 18 年度	7,900,000	0	7,900,000
平成 19 年度	7,400,000	2,220,000	9,620,000
総計	15,300,000	2,220,000	17,520,000

研究発表

- (1) 雑誌論文等
 - ① Y. Nakama, S.Nagamachi, J.Ohta and M.Nunoshita, "Position-controlled Si nanocrystals in a SiO₂ thin film using a novel amorphous Si ultra-thin-film

"nanomask" due to a bio- nanoprocess for low-energy ion implantation", Appl. Phys. Express 1, 2008, pp.034001-3.

- ② Y.Nakama, J.Ohta and M.Nunoshita, "High-density and very small-size Ge_{1-x}C_x nanocrystal assemblies on a Si(100) substrate fabricated using bio-nanoprocess with proteins "ferritin" and solid source molecular beam epitaxy", Jpn. J. Appl. Phys., 47(4), 2008, pp.3028-3031.
- (3) Y. Nakama, K. Minakawa, J. Ohta, and M. Nunoshita, "Very small-size and high-density β -FeSi₂ nanocrystal assemblies grown on a Si(100) substrate using an embedded solid-phase epitaxy and bionanoprocess with protein ferritin", Appl. Phys. Lett. **91**, 203102

(2007).

- ④ Y. Nakama, J. Ohta, and M. Nunoshita, "Precise size control of Si nanocrystals in a SiO₂ thin film using low-energy ion implantation and novel two-step annealing with RTA and a Nd:YAG pulse laser", submitted to Jpn. J. Appl. Phys.
- (2) 学会発表
- Y. Nakama, J. Ohta, and M. Nunoshita, "MBE-grown Ge_{1-x}C_x nanocrystals by using a novel bio-nanoprocess due to protein 'ferritin'", 2007 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2007), Tukuba, Japan, F-6-1, (2007).
- (2) Y. Nakama, K. Minakawa, J. Ohta, and M. Nunoshita, "Fabrication of the two-dimensional superlattice structure made of Ge_{1-x}C_x nanocrystals" 6th GIST/NAIST Joint Symposium on Advanced Materials, Nara, Japan, 2006/11, Announcement schedule
- ③ 中間勇二,皆川亨介,太田淳,布下正宏,「バイオナノプロセスを用いた GeC ナノクリスタルの作製」,第54回応用物理学関係連合講演会,29p-SB-5(青山学院大学,2007年3月)
- ④皆川亭介,中間勇二,太田淳,布下正宏,「バイオナノプロセスと埋め込み SPE 法を用いた 高密度β-FeSi2ナノ結晶の形成」,第54回応用物理学関係連合講演会,29p-SB-6(青山学 院大学,2007年3月)
- ⑤ 中間勇二,皆川亨介,太田淳,布下正宏,「フェリチンタンパク質を用いたナノマスクの作 製」,第67回応用物理学会学術講演会,31p-RB-7(立命館大学,2006年8月)
- (3) 図書/出版物
 - ① 仲間勇二,「バイオナノプロセスを用いたIV族系半導体ナノクリスタルの作製と精密制御の 研究」,学位論文,2008年3月.

研究成果による産業財産権の出願・取得状況

なし

研究成果

Si系発光デバイス等を目指して、新しいバイオナノプロセスとトップダウン式の MBE 法、SPE 法、イオン注入法等を融合させ、Si 基板上に GeC、8-FeSi₂、Si それぞれのナノクリスタル(NC) の 2 次元精密配列(超格子)の形成技術を開発した。得られた新しい知見は次の通りである。

- (1) Si(100)基板上に作製した 2nm 厚極薄膜 Si ナノマスクの微小孔を介し、真空アークプラズマガンの C 分子線源に用いて分子線エピタキシー(MBE)選択成長により直径 7±2nm、ピッチ 12nm にほぼ 2 次元配列した GeC-NC の形成に初めて成功し、その PL スペクトルを観測した。NC 化により Ge1-xCx の格子点 C 組成 x=3.2%を達成したが、目標の x≥4%とバンドボーイングの 克服による直接遷移型バンド構造は実現できなかった。[Jpn.J.Appl.Phys.47(4)2008]
- (2)上記のSiナノマスクを介してSiO2薄膜中に0.6keVでSiイオンを超低加速注入(ドーズ量1×10¹⁶cm⁻²)し、Nd:YAGパルスレーザアニールを用いて直径3.0±0.3nm,間隔6nmのSi-NCの2次元超格子構造の形成に初めて成功し、波長600nmに強いPLピークを検出した。
 [Appl.Phys.Express,1,2008]
- (3)バイオナノプロセスによって Si(100)基板上に 2 次元配列した Fe 内包フェリチンのたんぱく質 を O₃ プラズマで除去し、PECVD チャンバ内において NH₃ プラズマで還元した Fe ナノドット カラムを同一チャンバ内で a-Si 薄膜を堆積・埋め込み、高真空中、800℃、1 時間の固相エピタ キシー法によって直径 6.0±0.4nm、12nm ピッチの均一な 8-FeSi₂ NC の 2 次元配列の形成とそ の PL スペクトルの観測に成功した。[Appl.Phys.Lett.,<u>91</u>,2007]

しかし、当初の計画であったSi系材料(GeC, β-FeSi₂)のナノクリスタルと二次元超格子の形成に は成功したが、バイオナノプロセスとキャップ層の開発に手間取り2年間ではこれらの発光デバイ スの開発およびGeC/Si混晶のバンドボーイングの解明と克服には到らなかった。

上記の研究成果の詳細は、以下のように発表論文、学会発表プロシーディングおよび研究協力者 仲間勇二君の博士論文を以って報告とする。